Monatshefte für Chemie Chemical Monthly

© by Springer-Verlag 1988

Synthese und Eigenschaften einiger *p*-tolyl-phenylsubstituierter Di- und Trisilane und von 1,1,1,3,3,3-Hexaphenyltrisilan

Karl Hassler

Institut für Anorganische Chemie, Technische Universität Graz, A-8010 Graz, Österreich

(Eingegangen 2. Dezember 1986. Revision 16. Oktober 1987. Angenommen 22. Oktober 1987)

Synthesis and Properties of Some p-Tolyl-phenyl Substituted Di- and Trisilanes and of 1,1,1,3,3,3-Hexaphenyltrisilane

The synthesis and properties of $[Ph_2p-TolSi]_2$, $[Ph_2p-TolSi]_2SiPh_2$, $[Ph_3Si]_2Si(p-Tol)_2$, $[Ph_2p-TolSi]_2Si(p-Tol)_2$ and $(SiPh_3)_2SiH_2$ are described. The silanes are identified using IR, Ra- and $^{29}Si-NMR$ -spectroscopy.

(Keywords: p-Tolylphenyltrisilanes; 1,1,1,3,3,3-Hexaphenyltrisilane; ²⁹Si NMR spectra)

Einleitung

Phenyl- und tolylsubstituierte Di- und Oligosilane stellen wegen der unterschiedlichen Reaktivität der Phenyl- und Tolylgruppen gegenüber flüssigen Halogenwasserstoffen (z. B. HBr [1]) potentielle Vorstufen zur Synthese halogensubstituierter Phenylsilane dar.

$$Si_n Ph_m(Tol)_{2n+2-m} \xrightarrow{HCl} Si_n Ph_m Cl_{2n+2-m}$$

Daraus können in zwei weiteren Schritten halogensubstituierte Silane erhalten werden:

$$Si_n Ph_m Cl_{2n+2} \xrightarrow{LiAlH_4} Si_n Ph_m H_{2n+2-m}$$

$$\operatorname{Si}_{n}Ph_{m}\operatorname{H}_{2n+2-m} \xrightarrow{\operatorname{H}X} \operatorname{Si}_{n}X_{m}\operatorname{H}_{2n+2-m} (X = \operatorname{Cl}, \operatorname{Br}, \operatorname{I})$$

Beispiele für letzteren Reaktionsweg sind etwa die Synthesen von $Si_2Cl_xH_{6-x}$ [2] oder der Brom- und Jodsilane $H_3Si-SiX_3$ und

1052 K. Hassler:

 $\mathrm{H}X_2\mathrm{Si} - \mathrm{Si}X_2\mathrm{H}$ [3, 4]. Soferne es gelingt, die phenylhalogensubstituierten Silane $\mathrm{Si}_n Ph_m \mathrm{Cl}_{2n+2-m}$ in reiner Form zu erhalten, sind die entsprechenden Halogensilane $\mathrm{Si}_n X_m \mathrm{H}_{2n+2-m}$ ($X=\mathrm{Cl},\mathrm{Br},\mathrm{I}$) in g-Mengen präparativ zugänglich. In dieser Arbeit wird die Synthese einer Reihe von Di- und Trisilanen beschrieben, die in weiterer Folge als Vorstufen zur Synthese von Chlor-, Brom- und Jodsilanen dienen sollen. Den Synthesen liegt folgendes literaturbekanntes Reaktionsschema zugrunde:

$$2 Ph_{2}pTol\text{SiCl} \xrightarrow{\text{Na}} Ph_{2}pTol\text{Si} - \text{Si}pTolPh_{2}$$

$$Ph_{2}pTol\text{Si} - \text{Si}pTolPh_{2} \xrightarrow{\text{Na/K}} 2 Ph_{2}pTol\text{SiK}$$

$$Ph_{2}pTol\text{SiK} = \begin{cases} Ph_{2}\text{SiCl}_{2} & [Ph_{2}pTol\text{Si}]_{2}\text{Si}Ph_{2} \\ Ph_{2}pTol\text{SiK} & [Ph_{2}pTol\text{Si}]_{2}\text{Si}Ph_{2} \end{cases}$$

$$Ph_{2}pTol\text{SiK} = \begin{cases} Ph_{2}pTol\text{Si}_{2} & [Ph_{2}pTol\text{Si}]_{2}\text{Si}pTol_{2} \\ Ph_{3}\text{SiK} & [Ph_{3}\text{Si}]_{2}\text{Si}H_{2} \end{cases}$$

$$Ph_{2}pTol\text{SiK} = \begin{cases} Ph_{2}pTol\text{Si}_{2} & [Ph_{3}\text{Si}]_{2}\text{Si}PTol_{2} \\ Ph_{3}\text{SiK} & [Ph_{3}\text{Si}]_{2}\text{Si}PTol_{2} \end{cases}$$

Phenyl- und Tolylgruppen unterscheiden sich in ihrer Reaktivität gegen HBr tatsächlich soweit, daß etwa mit $(Ph_2pTol\text{Si})_2\text{Si}Ph_2$ die Synthese von $(\text{Br}Ph_2\text{Si})_2\text{Si}Ph_2$ in guten Ausbeuten möglich ist $(K. \, Hassler, \, \text{in Vorbereitung})$.

Experimenteller Teil

1,2-Bis(p-Tolyl)tetraphenyldisilan

 $400\,\mathrm{g}\,(1.3\,\mathrm{mol})$ Diphenyl-p-Tolylchlorsilan [5] und $29.8\,\mathrm{g}\,(1.3\,\mathrm{mol})$ Na werden in $1\,500\,\mathrm{ml}$ Xylol erhitzt, bis das gesamte Natrium geschmolzen ist. Unter intensivem Rühren wird $12\,\mathrm{h}$ am Rückfluß gekocht. Nach dem Abkühlen der Lösung wird filtriert und der weiß-blaue Rückstand portionsweise in $1\,500\,\mathrm{ml}\,96\%$ Ethanol eingetragen. Der so erhaltene weiße Niederschlag wird abgetrennt, nochmals mit etwa $20\%\mathrm{igem}$ Ethanol gewaschen und bei etwa $120\,^{\circ}\mathrm{C}$ getrocknet. Zur weiteren Reinigung wird aus Toluol umkristallisiert. Das so erhaltene Produkt schmilzt bei $252\,^{\circ}\mathrm{C}$. Die Ausbeute beträgt etwa $300\,\mathrm{g}\,(84\%)$. Elementaranalyse $\mathrm{Si}_2\mathrm{C}_{38}\mathrm{H}_{34}$ (ber./gem.): C83.46/83.21, H6.27/6.55, Si10.27/10.10.

p-Tolyldiphenylsilylkalium

Die Darstellung erfolgt nach der von Gilman [6] angegebenen Arbeitsvorschrift für Triphenylsilylkalium, wobei aber wesentlich größere Mengen an Diethylether notwendig sind. Andernfalls ist die entstehende Suspension der Kaliumverbindung so dickflüssig, daß eine Dosierung mittels Tropftrichters nahezu unmöglich ist.

Zur Darstellung des p-Tolyldiphenylsilylkaliums werden 30 g [p-TolPh₂Si]₂ in etwa 1000—1500 ml Diethylether suspendiert und 10 g einer Na/K-Legierung (bereitet aus 200 g Kalium und 40 g Natrium) zugegeben. Das Einsetzen der Reaktion ist am Auftreten einer bräunlich-grünen Verfärbung zu erkennen, zur Vervollständigung wird noch 36—48 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird das überschüssige Alkalimetall durch Amalgamieren mit Quecksilber gebunden und die überstehende Suspension in einen Tropftrichter übergeführt. Während des Zutropfens ist auf eine gute Durchmischung zu achten, um ein einigermaßen gleichmäßiges Dosieren zu gewährleisten.

1,3-Bis-p-Tolylhexaphenyltrisilan

50 g (91 mmol) [p-TolPh₂Si]₂ werden wie beschrieben mit Na/K-Legierung umgesetzt und die entstehende Suspension von p-TolPh₂SiK langsam und unter Eiskühlung zu einer Lösung von 23 g (91 mmol) Ph₂SiCl₂ in etwa 1 000 ml Et₂O zugetropft. Nach Beendigung der Reaktion wird noch einige Zeit am Rückfluß erhitzt und sodann ein Großteil des Diethylethers destillativ entfernt. Man gibt etwa 1 500 ml Toluol zu und destilliert so lange weiter, bis am Kolonnenkopf die Siedetemperatur des Toluols erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird heiß über eine Umkehrfritte filtriert, das Toluol im Vak. abgezogen und der Rückstand aus einem Gemisch von Essigester/Toluol umkristallisiert (etwa 150—200 ml Toluol auf 11 Essigester).

Die Ausbeute beträgt etwa 30 g (45%), Schmelzpunkt: 192—196 °C. Elementaranalyse $Si_3C_{50}H_{44}$ (ber./gem.): C 82.36/82.14, H 6.08/6.32, Si 11.55/11.44.

2,2-Bis-p-Tolylhexaphenyltrisilan

50 g (96.5 mmol) Hexaphenyldisilan Si_2Ph_6 werden nach *Gilman* [6] mit Na/K-Legierung zu Triphenylsilylkalium Ph_3SiK umgesetzt und langsam unter Eiskühlung zu einer Lösung von 27.1 g (96.5 mmol) $(p-Tol)_2SiCl_2$ in etwa 1 000 ml Diethylether zugetropft. Der Ether wird wieder durch Toluol ersetzt. Man filtriert heiß, beim Abkühlen scheidet sich $(SiPh_3)_2Si(p-Tol)_2$ in Form farbloser Kristalle ab. Nach weiterem Umkristallisieren aus Toluol erhält man etwa 40 g (57%) eines Produktes, das bei 228°C schmilzt. Elementaranalyse $Si_3C_{50}H_{44}$ (ber./gem.): C 82.36/82.66, H 6.08/6.28, Si 11.55/11.30.

1,2,2,3-Tetrakis-p-Tolyltetraphenyltrisilan

Eine aus 50 g (91.6 mmol) $[p\text{-}TolPh_2\mathrm{Si}]_2$ bereitete Suspension von $p\text{-}TolPh_2\mathrm{SiK}$ wird langsam und unter Eiskühlung zu einer Lösung 25.7 g (91.6 mmol) $(p\text{-}Tol)_2\mathrm{SiCl}_2$ in etwa 1 000 ml $Et_2\mathrm{O}$ zugetropft. Man ersetzt wieder den Ether durch Toluol und filtriert heiß von den gebildeten Salzen. Nach dem Abziehen des Lösungsmittels erhält man etwa 40 g $(p\text{-}TolPh_2\mathrm{Si})_2\mathrm{Si}p\text{-}Tol_2$ (\sim 58%) als gelbliches Öl, das keinerlei Neigung zur Kristallisation zeigt. Versuche mit etwa fünfzehn verschiedenen Lösungsmitteln bzw. Lösungsmittelgemischen erbrachten nie Kristalle, so daß keine befriedigende Reinigung möglich war. Das $^{29}\mathrm{Si}\text{-}\mathrm{NMR}$ -

1054 K. Hassler:

Spektrum zeigt neben den beiden Linien des Trisilans (s. Tabelle 2) noch ein weiteres schwaches Signal bei +2.76 ppm und verstärktes Rauschen der Grundlinie, und die Elementaranalyse erreicht nicht die sonst übliche Genauigkeit. Die Reinheit der Substanz dürfte grob geschätzt bei etwa 90% liegen. (Die Elementaranalysen aller bisher beschriebenen Silane wird noch dadurch erschwert, daß die Substanzen oft nicht vollständig verbrennen und die Analysen mehrmals wiederholt werden müssen.) Elementaranalyse: Si $_3$ C $_{52}$ H $_{48}$ (ber./gem.): C 82.48/80.74, H 6.39/7.03.

1,1,1,3,3,3-Hexaphenyltrisilan

37.4 g (131.7 mmol) Dijodsilan I_2SiH_2 werden in etwa 300 ml Diethylether vorgelegt und bei $-70\,^{\circ}$ C langsam mit einer Suspension von KSi Ph_3 in Diethylether [bereitet aus 68.2 g (131.7 mmol) Si_2Ph_6] versetzt. Man rührt noch einige Stunden bei Zimmertemperatur, versetzt mit etwa 800 ml Toluol und destilliert den Diethylether vollständig ab. Von den gebildeten Salzen wird heiß filtriert, beim Abkühlen scheidet sich $(Ph_3Si)_2SiH_2$ in Form farbloser Kristalle ab. Mehrmaliges Umkristallisieren aus Toluol ergibt 30 g (41%) eines Produktes, das bei 210 °C schmilzt. Elementaranalyse: $Si_3C_{36}H_{32}$ (ber./gem.): C78.77/78.80, H 5.87/5.78, Si 15.35/15.55.

Spektren

Für die Infrarot- und Ramanspektren ist das Gebiet der SiSi- und SiC-Valenzschwingungen ($600-300\,\mathrm{cm}^{-1}$) von besonderem Interesse, da hier die größten Unterschiede für die einzelnen Verbindungen zu erwarten sind. Oberhalb dieses Bereiches liegen fast ausschließlich lagekonstante Phenylschwingungen, so daß in Tabelle 1 nur die Spektren unterhalb $900\,\mathrm{cm}^{-1}$ [ausgenommen ($\mathrm{Si}Ph_3$)₂ SiH_2] angegeben sind.

In perphenylierten Di-Oligo- und Cyclosilanen wie etwa Si_2Ph_6 [7], Si_3Ph_8 [8] oder Si_4Ph_8 [9] und Si_5Ph_{10} [10] sind die SiSi-Valenzschwingungen kopplungsbedingt in den Frequenzbereich zwischen 500 und $600 \,\mathrm{cm}^{-1}$ verschoben. Bei Ersatz einer Phenyl- durch eine Tolylgruppe sollten sie kaum beeinflußt werden.

Tatsächlich weisen alle in dieser Arbeit dargestellten Trisilane SiSi-Schwingungsfrequenzen auf, die jenen des Oktaphenyltrisilans (ν_s SiSi₂: 541 cm⁻¹, ν_{as} SiSi₂: 557 cm⁻¹ [8]) sehr nahe kommen. In 1,1,1,3,3,3-Hexaphenyltrisilan fallen ν_s und ν_{as} SiSi₂ zusammen.

1,2-Bis(p-tolyl)tetraphenyldisilan zeigt im IR-Spektrum keine SiSi-Valenzschwingung, im Ra-Spektrum tritt sie bei 559 cm⁻¹ auf (Si₂ Ph_6 : 566 cm⁻¹ [7]).

An den Bereich der SiSi-Valenzschwingungen schließt langwellig das Gebiet der y-Schwingungen (450—500 cm⁻¹) und der SiC-Valenzschwingungen (300—450 cm⁻¹) an, das für diagnostische Zwecke besonders gut geeignet ist. Zwischen den einzelnen Verbindungen gibt es hier deutliche Unterschiede, eine nähere Zuordnung der Banden ist aber ohne detaillierte Normalkoordinatenanalysen nicht möglich.

Tabelle 1. Infrarot- und Raman-Spektren ($< 900\,\mathrm{cm}^{-1}$) der p-Tolylphenylsilane und von Hexaphenyltrisilan

		$ ho_{ m s,as}^{ m v_{s,as}SiH_2} ho_{ m s,as}^{ m SiH_2}$	ÿSIH ₂					vSiSi	S.S.	, G:G:	V _s SiSi ₂													
.2	Ra(s)	2079 m 894 m, b	wm c/o				w 809	:		520 ms	10	487 vw				428 mw				359 w	350 w	335 w	318 vw	
[Ph ₃ Si] ₂ SiH ₂	IR(s)	2075 s 895 s	670 m 855 w 800 w	735 vs	895 vs	ļ	630 m 615 m			515 vs, b		490 vs	475 vs		445 mw	428 m			390 vw	360 m	$350\mathrm{mw}$		318 w	290 s
$[pTolPh_2Si]_2SipTol_2$	IR(s)		850 w	800 s 740 s	200 s	676 vs	624 ms	11 C10	540 01	540 sn	220 s	498 s			460 m		430 w	400 m	384 m	360 m	354 m			
3i]Si <i>Ph</i> 2	Ra(s)			804 ms 739 w	89 ms		629 m	01/111		m/cc	537 m	496 vvw			455 m	443 m			387 m		350 w			294 m
$[pTolPh_2Si]SiPh_2$	IR(s)		850 w	800 s 735 vs	895 vs	685 sh	622 s	0138	04.0	248 s	532 s	495s	478 s		460 m		430 mw	415 m	380 s			332 vs	328 sh	
$pTol_2$	Ra(s)			794 ms 743 m	687 ms		631 m	MI C10	į	m ccc	539 m	491 vw	475 vw		455 m	443 m			387 w.b			339 vw		
$\boxed{[Ph_3Si]_2SipTol_2}$	IR(s)		855 mw	808 vs 735 vs	695 vs, b	678 m	625 m	010 w	Ç L	220 s	528 s	495 vs, b	475 sh	465 w	458 w	442 w	430 w	405 s	383 s	360 s	350 mw	338 s		277 mw
)i] ₂	Ra(s)			796 m	691 mw	wm 679	620 m, b	550 m	┥				475 w		_	439 w			394 vw			316 w		
$\begin{array}{ccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$	IR(s)	atshefte für	M 058	735 vs		682 sh	620 m	010 W				495 vs	480 vs	470 sh	462 m	435s		410.8	390 w	370 s	345 m	320 vw	; ; ;	

⁷⁵ Monatshefte für Chemie, Vol. 119/10

Tabelle 2. ²⁹Si-Verschiebungen (ppm gegen TMS) der Di- und Trisilane

	δ (Si)	δ (*Si)			
$(Ph_2p\text{-}Tol)\mathrm{Si}_2$	- 23.7				
$[(Ph_2p-Tol)Si]_2*SiPh_2$	-18.8	- 42.2			
$[Ph_3Si]_2*SiPh_2$	-18.5	-41.4			
$[Ph_3Si]_2^2*SiH_2^2$	-15.3	-105.2			
$[Ph_3Si]_2$ *Si $(p-Tol)_2$	-19.0	-42.7			
$[(P\dot{h}_2p-Tol)\dot{S}i]_2*\dot{S}i(p-Tol)_2$	-19.2	-42.9			

Tabelle 2 gibt die ²⁹Si-Verschiebungen der Silane wieder. Die Verschiebungen der Tolylphenyltrisilane sind weitgehend identisch mit jenen von Si₃Ph₈, die Tolylgruppen bewirken lediglich eine Verschiebung zu höherem Feld um einige Zehntel ppm. Überraschenderweise ist der Trend bei $(Ph_2p-TolSi)_2$ gerade entgegengesetzt $(Si_2Ph_6: -26.6 \text{ ppm } [2])$. Die Verschiebung des zentralen Si-Atoms von (Ph₃Si)₂SiH₂ ist mit -105.2 ppm praktisch identisch jener von (Me_3Si)₂SiH₂ (-104.58 ppm).

Literatur

- [1] Hengge E, Eberhardt H (1979) Monatsh Chem 110: 39
- [2] Söllradl H, Hengge E (1983) J Organomet Chem 243: 257
- [3] Thomassen H. Hagen K. Stolevik R. Hassler K (1986) J Mol Struct 147: 331
- [4] Hassler K, Pöschl M, in Vorbereitung
- [5] Breed LW, Wiley JC (1976) J Polymer Sci 14: 83 [6] Gilman H, Wu TC (1953) J Org Chem 18: 753
- [7] Höfler F (1976) Monatsh Chem 107: 893
- [8] Höfler F (1973) Monatsh Chem 104: 694
- [9] Höfler F (1976) Monatsh Chem 107: 411
- [10] Hengge, E, Lunzer F (1976) Monatsh Chem 107: 371